Magdalena Kowalewska¹, Maria Trzaska²

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa

CHARAKTERYSTYKA WARSTW KOMPOZYTOWYCH Ni/Si₃N₄

Zaprezentowano wyniki badań procesu wytwarzania metodą redukcji elektrochemicznej warstw kompozytowych z osno-wą niklową i dyspersyjną fazą ceramiczną Si₃N₄. Do wytwarzania warstw stosowano w pierwszym przypadku kąpiel Wattsa zawierającą mikrometryczny proszek azotku krzemu, a w drugim kąpiel Wattsa zmodyfikowaną substancją organiczną D1 i zawierającą nanometryczny proszek Si₃N₄. Przedstawiono wyniki analizy składu fazowego proszków Si₃N₄ stosowanych do wytwarzania warstw kompozytowych. Zaprezentowano wyniki badań wpływu substancji organicznej zawartej w kąpieli Wattsa na strukturę wytwarzanych warstw. Przeprowadzono analizę zarówno składu chemicznego materiału wytworzonych warstw kompozytowych, jak i ukształtowania ich powierzchni oraz zidentyfikowano badania twardości wytworzonych warstw kompozytowych. Stwierdzono wzrost mikrotwardości materiału nanokrystalicznych warstw kompozytowych Ni/Si₃N₄ z nanodyspersyjną fazą ceramiczną azotku krzemu w stosunku do ich mikrometrycznych odpowiedników.

Słowa kluczowe: warstwy niklowe, nanokrystaliczne warstwy kompozytowe, struktura, mikrotwardość

CHARACTERISTICS OF COMPOSITE LAYERS Ni/Si₃N₄

Composite layers with nickel matrix and micro- and nano-sized Si_3N_4 disperse phase were examined. The layers have been produced by the electrochemical method in Watts bath. In the first case the used Watts bath contained of micro-sized Si_3N_4 powder and in the second case the Watt's bath has been filled with an organic substance and contained of Si_3N_4 powder nanoparticles. Investigations of the phase composition of Si_3N_4 powders are performed (Fig. 1). Figures 2 and 3 show how the presence of the organic substance in the Watts bath influences on structure of nickel layers. Results of morfology examinations of the composite layers are shown in Figure 4. Distributions of Si_3N_4 phases in nickel matrix are show in Figure 5. Table 2 shows the results of the chemical analysis of the elements building layers. Investigations of the disperse ceramic phase Si_3N_4 in the material of the composite layers were performed. Results of examinations of the hardness of the Ni/Si_3N_4 layers, respectively, are reported (Table 3). Increases of the microhardness of nanocrystalline composite layers are identified.

Key words: nickel layers, nanocrystalline composite layers, structure, microhardness

WPROWADZENIE

Elektrochemiczne osadzanie warstw kompozytowych jest obecnie szeroko stosowaną w praktyce metodą, gdyż pozwala uzyskiwać materiały o pożądanych właściwościach. Ponadto metoda redukcji elektrochemicznej charakteryzuje się dużą szybkością nakładania warstw, możliwością realizacji procesu w stosunkowo niskich temperaturach, rzędu 50°C. Metoda ta zapewnia dobrą adhezję warstwy do podłoża i daje możliwość wytwarzania warstw o dowolnej grubości.

Właściwości warstw, które decydują o jakości wyrobu, jego prawidłowym działaniu oraz okresie użytkowania zależą zarówno od składu chemicznego, jak i struktury materiału, z którego są zbudowane. Na skład chemiczny oraz strukturę materiału warstwy można wpływać poprzez skład i pH kąpieli, temperaturę procesu wytwarzania, a także przez rodzaj zastosowanego prądu i jego gęstość.

Wykorzystując nikiel jako materiał osnowy, a jako fazę dyspersyjną azotek krzemu można, przez odpo-

wiednią technologię procesu, osiągnąć, między innymi, zwiększenie odporności na zużycie przez tarcie i wzrost twardości materiału warstwy, poprawę odporności korozyjnej wytworzonych warstw oraz wielu innych ich właściwości użytkowych [1-3].

Połączenie takich komponentów, jak Ni oraz Si₃N₄, metodą elektrochemiczną umożliwia powstanie dzięki procesom elektroforezy cząstek dyspersyjnej fazy ceramicznej oraz elektrokrystalizacji osnowy, trwałego i wytrzymałego połączenia tak znacznie między sobą różniących się materiałów, jakimi są metal i ceramika.

Zwiększając stopień dyspersji zarówno materiału osnowy, jak i fazy ceramicznej można uzyskać nanokompozytowe warstwy powierzchniowe charakteryzujące się znacznie korzystniejszymi właściwościami użytkowymi w stosunku do ich klasycznych odpowiedników [4-7].

Do wytwarzania warstw kompozytowych metodą redukcji elektrochemicznej stosuje się kąpiele stanowiące

¹ mgr inż., ² prof. dr hab. inż.

mieszaninę dyspersyjnej fazy ceramicznej i wieloskładnikowego elektrolitu. W takim stanie cząstki fazy ceramicznej o silnie rozwiniętej powierzchni tworzą z elektrolitem niejednorodny i termodynamicznie niestabilny układ dwufazowy. Wbudowanie cząstek fazy ceramicznej w niklową osnowę wymaga więc odpowiedniej ich dyspersji oraz wytworzenia trwałej zawiesiny w kapieli w warunkach realizacji procesu, co jest niezwykle trudne w przypadku stosowania faz nanodyspersyjnych [8, 9]. Wynika to z tego, że trwałość analizowanego układu zależy w dużym stopniu od wymiarów czastek fazy ceramicznej, składu elektrolitu, jego gęstości i wymaga ciągłego mieszania kąpieli w czasie trwania procesu osadzania warstw, co zapobiega sedymentacji cząstek ceramicznych oraz zapewnia jednorodność stężeń wszystkich składników w całej objętości kapieli.

Przedmiotem badań przedstawionych w niniejszej pracy są warstwy kompozytowe Ni/Si₃N₄ i warstwy nanokompozytowe Ni/Si₃N₄, które zostały wytworzone metodą redukcji elektrochemicznej. Celem tych badań było porównanie struktury i topografii mikrokrystalicznych warstw kompozytowych Ni/Si₃N₄ z warstwami nanokompozytowymi Ni/Si₃N₄, a także określenie ich mikrotwardości. W celach porównawczych badano również warstwy niklowe o strukturze mikro- i nanokrystalicznej wytwarzane elektrochemicznie.

CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA

Warstwy niklowe i kompozytowe Ni/Si₃N₄ wytwarzane były metodą redukcji elektrochemicznej w kąpielach o składach przedstawionych w tabeli 1. Jako podłoże dla osadzanych warstw stosowano standardowo przygotowane próbki płaskie ze stali S235JR. Aby zapobiec sedymentacji cząstek proszku oraz zapewnić jednorodność zawiesiny i ułatwić transport cząstek fazy ceramicznej w czasie procesu, stosowano mechaniczne mieszanie kąpieli. Proces osadzania warstw realizowano przy gęstości prądu 3 A/dm² w kąpieli o temperaturze 320 K. Czas osadzania wszystkich warstw był taki sam i wynosił 40 min.

TABELA 1. Składy kąpieliTABLE 1. Compositions of the baths

| Skladniki | Kąpiele | | | |
|-------------------------------------|---------|----|-----|----|
| Skiadniki | Ι | II | III | IV |
| NiSO ₄ 7H ₂ O | + | + | + | + |
| NiCl ₂ 6H ₂ O | + | + | + | + |
| H ₃ BO ₃ | - | + | + | + |
| Substancja organiczna D1 | - | + | + | + |
| $Si_3N_4(\mu m)$ | - | - | + | - |
| $Si_3N_4(nm)$ | - | - | - | + |
| Środek powierzchniowo czynny | - | - | - | + |

Ceramiczną fazę dyspersyjną, którą stosowano do wytwarzania warstw kompozytowych Ni/Si₃N₄ o mikrokrystalicznej strukturze stanowił polidyspersyjny proszek Si₃N₄, zawierający obie odmiany krystaliczne α i β o budowie heksagonalnej (rys. 1a). Analiza wymiarowa wykazała, że 80% objętości proszku stanowiły ziarna o wymiarach od 0,1÷1µm, 10% ziarna o wymiarach od 1÷2 µm i 10% ziarna o wymiarach powyżej 2 µm.



Rys. 1. Dyfraktogramy proszku Si₃N₄: a) krystalicznego, b) amorficznego
Fig. 1. Diffraction patterns of the Si₃N₄ powder: a) crystalline, b) amorphous

Do wytwarzania kompozytowych warstw Ni/Si₃N₄ o nanometrycznej strukturze stosowany był amorficzny proszek azotku krzemu (rys. 1b) o średnim wymiarze ziaren 15 nm. Oba rodzaje warstw kompozytowych osadzane były w kąpielach zawierających 20 g proszku w 1 dm^3 kąpieli.

Strukturę materiału warstw niklowych Ni, stanowiących osnowę materiału kompozytowego, badano za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM) JEM-I200EXII. Obrazy powierzchni i profile przekroju wytworzonych warstw niklowych i kompozytowych badano za pomocą mikroskopu sił atomowych NanoScope MultiMode firmy Digital Instruments. Budowę wewnętrzną warstw kompozytowych, ich grubość oraz rozmieszczenie cząstek fazy ceramicznej w objętości materiału kompozytowego, a także skład chemiczny materiału określono na podstawie badań zgładów metalograficznych przekrojów poprzecznych warstw analizowanych za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego HITACHI S-3500N wyposażonego w spektrometr EDS (Normana Vantage).

Zawartość fazy dyspersyjnej Si_3N_4 w materiale kompozytowym wytworzonych warstw wyznaczono metodami metalografii ilościowej oraz komputerowej analizy obrazu. Analizę ilościową struktury warstw realizowano metodą punktową w oparciu o odpowiednie programy komputerowe.

Mikrotwardość materiału warstw niklowych i kompozytowych oraz materiału podłoża określono metodą Vickersa z wykorzystaniem mikroskopu metalograficznego NEOPHOT wyposażonego w przystawkę Hannemana. Pomiar realizowano na metalograficznych zgładach poprzecznych przekrojów warstw przy obciążeniu 10 G (HV0,01).

WYNIKI BADAŃ

Warstwa niklowa wytworzona w kąpieli I, podstawowej, charakteryzuje się znacznie większym rozwinięciem powierzchni niż warstwa wytworzona w kąpieli II zmodyfikowanej substancją organiczną (rys. 2).



Rys. 2. Obrazy AFM powierzchni i profile przekroju wzdłuż linii wskazanych na obrazie warstw niklowych wytworzonych w kąpieli: a) I, b) II

Fig. 2. AFM surface images with profiles of cross-section along the lines indicated on the image of the nickel layers deposited in the bath: a) I, b) II

Wprowadzenie substancji organicznej do kąpieli stosowanej w procesie niklowania elektrochemicznego miało na celu zmniejszenie ziaren elektrokrystalizującego niklu do rozmiarów nanometrycznych.

Strukturę warstw Ni wytworzonych w kąpieli podstawowej i modyfikowanej przedstawiono na rysunku 3. Warstwy niklowe wytworzone w kąpieli I (rys. 3a) charakteryzują się dużymi ziarnami niklu i dużym zróżnicowaniem ich wymiarów oraz występowaniem granic bliźniaczych. Obraz dyfrakcyjny tej warstwy jest typowym obrazem dla materiałów polikrystalicznych z wyraźnie widocznymi refleksami pochodzącymi od odbicia fali elektronowej od płaszczyzn krystalograficznych. Natomiast warstwy niklowe wytworzone w kąpieli II (rys. 3b) charakteryzują się ultradyspersyjną strukturą o wymiarach pojedynczych ziaren rzędu 20 nm. Na



obrazach dyfrakcyjnych występują charakterystyczne dla materiałów nanokrystalicznych symetrycznie rozmieszczone pierścienie względem refleksu centralnego.

b)

a)

Rys. 3. Mikrostruktura warstw niklowych wytworzonych w kąpieli: a) I, b) nm $$\rm II$$

Fig. 3. Microstructure of nickel layers deposited in the bath: a) I, b) II



- Rys. 4. Obrazy AFM powierzchni i profile przekroju wzdłuż linii wskazanych na obrazie warstw kompozytowych wytworzonych w kąpieli: a) I, b) II
- Fig. 4. AFM surface images with profiles of cross-section along the lines indicated on the image of the composite layers deposited in the bath: a) I, b) II

Powierzchnie warstw kompozytowych, jak i ich profile przedstawiono na rysunku 4. Z porównania obrazu powierzchni obu warstw kompozytowych widać wyraźnie, że zwiększenie stopnia dyspersji zarówno ziaren osnowy, jak i fazy ceramicznej wpływa istotnie na morfologię i ukształtowanie topografii powierzchni warstw kompozytowych.

Rozkład fazy dyspersyjnej w objętości wytworzonych warstw kompozytowych ilustrują przekroje poprzeczne warstw, zamieszczone na rysunku 5.



Rys. 5. Struktura w przekroju poprzecznym warstw kompozytowych wytworzonych w kąpieli: a) III, b) IV

Fig. 5. Image of the material composition in the cross section of the composite layers deposited in the bath: a) III, b) IV

Materiał obu warstw kompozytowych charakteryzuje się zwartą budową i równomierną grubością na całej pokrywanej powierzchni. Zarówno warstwa kompozytowa Ni/Si₃N₄ z wbudowaną mikrometryczną fazą ceramiczną, jak i warstwa kompozytowa o nanometrycznej strukturze charakteryzują się równomiernym rozmieszczeniem cząstek proszku Si₃N₄ w osnowie Ni. Warstwa wytworzona w kąpieli III, zawierająca mikrometryczną fazę ceramiczną Si₃N₄, osadzała się z mniejszą szybkością niż warstwa nanokompozytowa wytworzona w kąpieli IV, o czym świadczy mniejsza jej grubość (rys. 5). W tabeli 2 podano wyniki analizy składu chemicznego materiału wytworzonych warstw odniesionej do obszarów w przekroju poprzecznym warstw przedstawionych na rysunku 5.

Materiał wytwarzanych warstw kompozytowych Ni/Si₃N₄ charakteryzuje się heterogeniczną budową wewnętrzną i składa się z twardej dyspersyjnej fazy ceramicznej osadzonej w niklowej osnowie. Udział objętościowy fazy ceramicznej Si₃N₄ w warstwach kompozytowych wytwarzanych w kąpieli III jest rzędu 14%, a w przypadku warstw wytworzonych metodą redukcji elektrochemicznej w kąpieli IV, zmodyfikowanej substancją organiczną D1 i zawierającą nanodyspersyjny proszek azotku krzemu, jest bliski 8%.

Wyniki badań mikrotwardości zamieszczono w tabeli 3.

TABELA 2. Sklad chemiczny warstw TABLE 2. Chemical composition of the layers

| Składniki warstwy | Zawartość pierwiastków w warstwie % wag. | | | | |
|----------------------|--|-------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | Ni I | Ni II | Ni/Si ₃ N ₄ III | Ni/Si ₃ N ₄ IV | |
| Ni | 98,3 | 96,5 | 94,85 | 95,92 | |
| Si | - | - | 3,16 | 1,04 | |
| Ν | _ | _ | 0,89 | 0,34 | |
| Inne: Fe, C, O | 1,7 | 3,5 | 1,1 | 2,7 | |

TABELA 3. Mikrotwardość wytworzonych warstw TABLE 3. Microhardness of the layers

| Mikrotwardość HV0,01 | | | | | | |
|----------------------|------|-------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| S235JR | Ni I | Ni II | Ni/Si ₃ N ₄ III | Ni/Si ₃ N ₄ IV | | |
| 95 | 130 | 640 | 250 | 550 | | |

Zrealizowane badania wykazały, że warstwa niklowa wytworzona metoda elektrochemiczna w kapieli I ma o ponad 20% większą twardość niż materiał podłoża ze stali S235JR. Natomiast po wbudowaniu w taka warstwę twardych cząstek ceramicznych Si3N4 twardość wypadkowa materiału warstwy wzrosła od 130 do 250 HV0,01. Warstwa niklowa wytworzona w kapieli II zmodyfikowanej substancją organiczną D1 charakteryzuje się już pięciokrotnie większą twardością niż jej mikrokrystaliczny odpowiednik warstwy niklowej. Związki organiczne zawarte w kapieli podczas procesu elektrokrystalizacji, wbudowując się w warstwę, zmieniają jej strukturę i właściwości. Cząsteczki substancji organicznej adsorbują się na zarodkach kryształów, hamując ich wzrost, co sprzyja formowaniu się nowych zarodków i w efekcie powoduje powstawanie powłok drobnokrystalicznych. Konsekwencją zmiany tekstury oraz wbudowywania w warstwę cząsteczek substancji organicznej i produktów jej rozkładu jest zmiana właściwości fizycznych, a szczególnie twardości niklu. Natomiast warstwy kompozytowe Ni/Si₃N₄ o nanokrystalicznej osnowie z nanodyspersyjną fazą ceramiczną wykazują nieco mniejszą twardość niż warstwy niklowe o nanokrystalicznej strukturze.

Symetryczny kształt odcisków piramidy wgłębnika Vickersa we wszystkich badanych przypadkach wskazywał na jednorodność materiału badanych warstw.

PODSUMOWANIE

W pracy przedstawiono wyniki badań, które wykazały, że metodą elektrochemiczną można wytworzyć zarówno warstwy kompozytowe Ni/Si₃N₄, jak i warstwy nanokompozytowe Ni/Si₃N₄ o nanokrystalicznej osnowie niklowej i nanometrycznych wymiarach cząstek fazy ceramicznej.

Wszystkie wytworzone warstwy kompozytowe Ni/Si₃N₄, podobnie jak i warstwy Ni, wytworzone metodą elektrochemiczną, charakteryzują się zwartą budową i jednakową grubością na całej pokrywanej powierzchni. Wbudowana faza ceramiczna jest równomiernie rozmieszczona w objętości wytworzonych warstw kompozytowych.

Stwierdzono, że wbudowanie dyspersyjnej twardej fazy ceramicznej Si₃N₄ w mikrokrystaliczną osnowę Ni powoduje znaczne zwiększenie twardości materiału, natomiast nanodyspersyjna faza azotku krzemu wbudowana w nanokrystaliczną osnowę niklową powoduje zmniejszenie jej twardości o niecałe 15%. Z drugiej strony taki kompozytowy materiał nanokrystaliczny wykazuje wzrost twardości w stosunku do mikrokrystalicznego materiału kompozytowego.

LITERATURA

- Trzaska M., Kowalewska M., Wpływ zawartości Si₃N₄ w elektrolitycznych warstwach niklowych na zmianę ich właściwości trybologicznych, Archiwum Nauki o Materiałach 2002, 23, 2, 151-164.
- [2] Trzaska M., Warunki wytwarzania i właściwości warstw kom- pozytowych, Inżynieria Materiałowa 2000, 119, 6, 460-462.
- [3] Trzaska M., Wyszyńska A., Kowalewska M., Odporność korozyjna warstw kompozytowych z osnową niklową i dyspersyjną fazą ceramiczną, Kompozyty (Composites) 2002, 2, 5, 338-341.
- [4] Ciszewski A., Posłuszny S., Milczarek G., Baraniak M., Effects of saccharin and quaternary ammonium chlorides on the electrodeposition of nickel from a Watts-type electrolyte, Surface and Coatings Technology 2004, 183, 127-133.
- [5] Steinbach J., Ferkel H., Nanostructured Ni-Al₂O₃ films prepared by DC and pulsed DC electroplating, Scripta Materialia 2001, 44, 1813-1816.
- [6] Zimmerman A.F., Clark D.G., Aust T.K., Erb U., Pulse electrodeposition of Ni-SiC nanocomposite, Materials Letters 2002, 52, 85-90.
- [7] Jeong D.H., Gonzalez F., Palumbo G., Aust K.T., Erb U., The effect of grain size on the wear properties of electrodeposited nanocrystalline nickel coatings, Scripta Materialia 2001, 44, 493-499.
- [8] Steinhäuser S., Lampke T., Wielage B., Jakob C., Erler F., Corrosion behavior of electroplated composite coatings with nanoscaled particles, Physico-Chemical Mechanics of Materials 2004, 4, 604-607.
- [9] Kowalewska M., Trzaska M., Nanokrystaliczne warstwy kompozytowe Ni-Al₂O₃ - wytwarzanie i struktura, Kompozyty (Composites) 2004, 4, 9, 99-103.

Recenzent Ludosław Stobierski